

Small sputtering equipment

小型スパッタ装置

Sputtering equipment for R&D and Small-Scale Production 研究開発装置 EB1000 / 小規模生産装置 EB1100

- 小型·低価格 Compact and low cost
- 多層成膜に対応 Multi-layer deposition
- 簡単操作 Easy operation
- 高い拡張性
 High expandability

研究開発

Sputtering equipment for R&D



研究開発・小規模生産

Sputtering equipment for R&D and small scale production



EB1100

多様なニーズに充実の ラインナップで応えます。

Applicable for various needs with abundant option

Canon

Enabling nano level micro fabrication by ultra high vacuum

超高真空が実現するナノレベルの微細加工

CANON ANELVA Equipment solution キヤノンアネルバの装置ソリューション





NC8000 / EC8000 ドライエッチング装置 NC8000/EC8000 Dry Etching Equipment



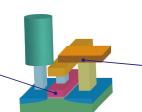
スパッタリング装置 NC7900/EC7800 Sputtering Equipment

EC7400 RF Filter Device スパッタリング装置 EC7400 Sputtering Equipment EC7420 スパッタリング装置 FC7420 Sputtering Equipment EC7430 **BC7000** スパッタリング装置 原子拡散接合装置 EC7430 BC7000 Atomic Diffusion

DRAM



FC7100 スパッタリング装置 Sputtering Equipment



IC7200 / IC7500 スパッタリング装置 IC7200/IC7500 Sputtering Equipment

HDD



ML3000シリーズ スパッタリング装置 ML3000 Series Sputtering Equipment



Sputtering Equipment Bonding Equipmentng

HC7100 / HC7300 スパッタリング装置 HC7100HC7300 Sputtering Equipment

Advanced Packaging

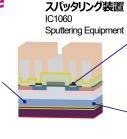


EL3400 スパッタリング装置 EL3400 Sputtering Equipment

Power Device



カーボンキャップ+ 活性化アニール装置 EC7200 C-Cap+



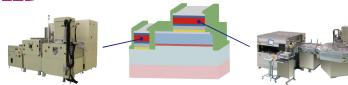
IC1060

BC7000

EC7200 Activation Anneal Equipment

原子拡散接合装置 BC7000 Atomic Diffusion Bonding Equipmentng

LED



EL3000シリーズ スパッタリング装置 FI 3000 Series Sputtering Equipment

EC8100

スパッタリング装置 FC8100 Sputtering Equipment

Photo Mask



EC7700 スパッタリング装置 FC7700 Sputtering Equipment

